

V 資料

1. 沿革詳細

昭和2年4月	商工大臣より工業試験場の設立認可。
昭和3年7月	秋田市土手長町に、秋田県工業試験場工芸部を設置。
昭和12年5月	秋田県工業指導所と改称し、秋田市茨島に移転。
昭和17年1月	秋田県角館権工芸指導所設立。
昭和21年4月	秋田県川連漆工芸指導所設立。
昭和30年9月	秋田県工業試験場と改称。秋田県角館権工芸指導所、秋田県川連漆工芸指導所の名称を、それぞれ秋田県工業試験場角館指導所、秋田県工業試験場川連指導所と改称。
昭和36年6月	秋田県工業試験場に秋田県工業試験場能代指導所、同大館指導所を設置。
昭和37年4月	科・係制に組織を改め、庶務係、機械化学科、工芸科、木工科を設置。
昭和41年4月	本場に土木試験科を設置。
昭和41年7月	本場本館竣工。
昭和42年4月	機械化学科を機械金属科、化学科の2科に分離。
昭和43年1月	高周波焼入試験工場並びに木材人工乾燥工場竣工。
昭和43年3月	工業試験場角館指導所を廃止。
昭和43年4月	工芸科をデザイン科と改称、工業試験場大館指導所を秋田県林業試験場へ移管。
昭和46年8月	講堂、会議室、非破壊試験室竣工。
昭和47年6月	化学科を工業化学科、木工科を工芸技術科と改称。
昭和48年4月	工業試験場に技術情報室設置。
昭和49年3月	機械金属科実験棟改築工事完成。恒温恒湿室設置。
昭和57年10月	秋田県工業技術センターと改称し、秋田市新屋町字砂奴寄に新築、移転。
昭和58年3月	工業技術センター能代指導所を廃止。
昭和61年	県議会高度技術産業・交通対策特別委員会から「本県独自の技術基盤を構築するための高度な研究機関設置の必要性」の提言。
昭和61年4月	組織改正、企画管理部を企画室と改称。応用開発室を設置。機械金属部と工業化学部を統合し機械化学部、木材部とデザイン部を統合し木材デザイン部と改組。
平成4年3月	秋田県条例第34号により「秋田県高度技術研究所」の設置を公布。
平成4年9月	同研究所の建物完成。(砂奴寄に新築、敷地面積23,130 m ² 、延床面積6,500 m ² (内クリーンルーム300 m ²))
平成4年11月	同研究所、開設。
平成7年4月	工業技術センター木材デザイン部を廃止。

平成 8 年 4 月	工業技術センターの部門で、応用開発室を情報システム開発部とメカトロニクス開発部に、機械化学部を工業材料部と生産技術部にそれぞれ 2 部に分離。建設技術部を建設・環境システム部と改組。
平成 8 年 4 月	工業技術センターに開放研究室を設置。
平成 8 年 8 月	工業技術センターが特許庁から知的所有権センターとして認定。
平成 11 年 3 月	工業技術センター川連指導所を廃止。
平成 12 年 4 月	建設・環境システム部を環境システム部と改称。
平成 14 年 4 月	工業技術センターの組織改編により、部制を廃止しグループ制とする。(情報システム開発部、メカトロニクス開発部、工業材料部、生産技術部、環境システム部をそれぞれ情報システムグループ、メカトロニクスグループ、工業材料グループ、生産技術グループ、環境システムグループと改組。)
平成 15 年 4 月	生産技術グループを生産システムグループと精密加工グループに改称。
平成 17 年 4 月	グループ制を廃止し、チーム制とする。(財)秋田県資源技術開発機構(小坂町)の研究部門を包括。(情報システムグループ、メカトロニクスグループ、工業材料グループ、生産システムグループ、精密加工グループ、環境システムグループの 6 グループ制から、プロジェクト研究チーム、技術応用化研究チーム、リサイクル技術開発チームの 3 チーム制。)
平成 17 年 5 月	工業技術センターと高度技術研究所が統合し、産業技術総合研究センターに改称。組織改編により、部門を総務管理部、経営企画部、工業技術センター、高度技術研究所へ改組。
平成 23 年 4 月	産業技術総合研究センターを産業技術センターに改称。組織改編により、総務管理部、技術イノベーション部、素形材プロセス開発部、電子光応用開発部、先端機能素子開発部と部門を改組。
平成 30 年 4 月	組織改編により、総務管理部、技術イノベーション部、先進プロセス開発部、素形材開発部、電子光応用開発部、先端機能素子開発部と部門を改組。
令和 2 年 4 月	組織改編により、総務管理部、企画事業部、共同研究推進部、先進プロセス開発部、素形材開発部、電子光応用開発部、先端機能素子開発部と部門を改組。

2. 特許出願・登録状況

No.	名称	権利の別	発明者	出願日	登録日	出願番号	登録番号
1	微細加工方法と微細加工装置	特許	赤上陽一	H14.4.8	H18.11.2	2002-105059	3875907
2	電界により砥粒の分布及び配列を制御可能な砥石、その製造方法、表面仕上げ工法	特許	赤上陽一	H14.11.18	H17.6.10	2002-333677	3686652
3	電界砥粒による刃先研磨仕上げ方法、及び刃先を有する微細部品の作製方法	特許	赤上陽一	H15.2.21	H19.1.19	2003-043990	3906165
4	生分解性樹脂を用いた打揚げ花火用玉皮、及びその製造方法	特許	鎌田悟、工藤素	H15.6.24	H19.1.5	2003-179193	3897738
5	工用絶縁監視装置	特許	小笠原雄二、近藤康夫	H15.12.12	H21.10.2	2003-436531	4378749
6	高硬度、高ヤング率、高破壊靱性値を有するWC-SiC系焼結体	特許	杉山重彰	H16.9.27	H22.6.11	2004-279279	4526343
7	小径管の内側面仕上げ加工方法及び装置	特許	赤上陽一	H17.9.26	H22.2.26	2005-277534	4464897
8	TiB ₂ 基Ti-Si-C系複合セラミックス及びその焼結体製造方法	特許	杉山重彰	H18.3.29	H23.8.26	2006-089729	4809096
9	車椅子使用者のためのトレーニングマシン	特許	小笠原雄二、宮脇和人、沓澤圭一	H18.9.4	H21.11.6	2006-239125	4399569
10	電界下における誘電性砥粒を水に分散させた流体を用いた仕上げ方法及び仕上げ装置	特許	赤上陽一	H18.12.4	H23.7.15	2006-326935	4783719
11	TiC基Ti-Si-C系複合セラミックス及びその製造方法	特許	杉山重彰	H18.3.27	H23.8.26	2006-086240	4809092
12	核酸検出方法及び核酸検出キット	特許	赤上陽一	H19.3.15	H25.12.13	PCT/JP2007/ 055179 2008-505198	5429962
13	W-Ti-C系複合体及びその製造方法	特許	杉山重彰	H15.5.19	H23.10.21	2008-133093	4848394
14	非接触攪拌方法、非接触攪拌装置、それを用いた核酸ハイブリダイゼーション反応方法、反応装置、試料中の核酸を検出する方法、核酸検出装置、試料中の抗体を検出する方法、及び抗体検出装置	外国特許	赤上陽一、加賀谷昌美	H21.10.23	H24.10.9	12/604640	US8283120 B2
15	非接触攪拌方法、非接触攪拌装置、それを用いた核酸ハイブリダイゼーション反応方法、反応装置、試料中の核酸を検出する方法、核酸検出装置、試料中の抗体を検出する方法、及び抗体検出装置	特許	赤上陽一、加賀谷昌美	H21.10.22	H27.1.23	2009-243468	5681912
16	WC-SiC系焼結体の製造方法	特許	杉山重彰	H16.9.27	H25.2.15	2010-007009	5198483
17	免疫組織染色方法および免疫組織染色装置	特許	赤上陽一、加賀谷昌美	H22.7.2	H26.10.17	2010-151695	5629850
18	砥粒の回収方法、及び回収装置	特許	赤上陽一、久住孝幸、池田洋	H22.7.9	H26.5.30	2010-156485	5548860
19	点滴モニタ装置	特許	小笠原雄二、佐々木信也、近藤康夫、熊谷健	H22.12.16	H27.2.20	2010-280437	5696297
20	基板の接合方法および基板接合装置	特許	木村光彦	H23.1.19	H26.11.28	2011-008905	5653232
21	WC基W-Mo-Si-C系複合セラミックス及びその製造方法	特許	杉山重彰	H23.3.24	H27.7.10	2011-066045	5771853
22	アクチュエータの減衰方法およびアクチュエータ	特許	森英季	H16.3.15	H16.11.5	2004-073233	3612670
23	アクチュエータ	特許	森英季	H18.3.30	H24.9.7	2006-095447	5076063
24	電磁界計測システム	特許	黒澤孝裕	H18.10.25	H24.2.3	2006-289985	4915565
25	位置決め機構	特許	森英季	H19.8.24	H24.7.6	2007-218965	5028659
26	液晶光学デバイス	特許	葉茂、佐藤進	H20.8.14	H23.11.18	2008-209004	4863403
27	高周波材料定数測定システム	特許	駒木根隆士、黒澤孝裕	H21.2.27	H26.8.8	2009-044983	5589180
28	空間光変調器	特許	山根治起	H21.5.11	H26.4.11	2009-114082	5514970
29	低電圧駆動液晶レンズ	特許	佐藤進、葉茂、王濱	H21.7.7	H25.8.9	2009-160358	5334116

No.	名称	権利の別	発明者	出願日	登録日	出願番号	登録番号
30	平面位置決め装置およびこれを備えた検査装置	特許	森英季、宮脇和人	H22.2.9	H26.9.5	PCT/JP2010/ 051900 2010-550522	5605227
31	低電圧駆動液晶レンズ	特許	佐藤進、葉茂、高橋慎吾	H22.3.1	H27.7.17	2010-044352	5776135
32	スピン注入電極構造、スピン伝導素子及びスピン伝導デバイス	特許	鈴木淑男	H22.9.3	H26.11.28	2010-198159	5651826
33	強磁性積層構造の製造方法	特許	鈴木淑男	H22.12.20	H27.2.6	2010-283253	5688526
34	液晶光学デバイス	特許	佐藤進、高橋慎吾、葉茂	H22.12.27	H28.4.1	2010-291221	5906366
35	液晶シリンドリカルレンズアレイおよび表示装置	特許	佐藤進	H23.1.6	H27.2.27	2011-001217	5699394
36	超音波流量計を用いた酸素濃度計	特許	小笠原雄二	H23.5.20	H28.5.27	2011-113374	5938597
37	液晶光学レンズ	特許	葉茂、佐藤進	H20.8.14	H24.12.21	2011-239597	5156999
38	磁気光学効果計測装置	特許	近藤祐治、山川清志	H23.5.31	H28.4.15	2011-122769	5914903
39	スピン注入電極構造、スピン伝導素子及びスピン伝導デバイス	外国特許	鈴木淑男	H23.8.24	H25.7.23	13/216965	US8492809 B2
40	強磁性積層構造及びその製造方法	外国特許	鈴木淑男	H23.12.13	H25.11.19	13/323869	US8586216 B2
41	液晶光学デバイス	特許	佐藤進、葉茂	H19.2.16	H22.1.8	2007-037047	4435795
42	マトリクス駆動液晶光学素子及び装置	特許	佐藤進	H24.6.26	H29.6.2	2012-143369	6149210
43	並進機構を用いたアクチュエータの減衰方法およびアクチュエータ	特許	森英季	H25.1.25	H28.10.28	2013-011990	6029063
44	研磨装置および研磨装置に用いられるアタッチメント	特許	赤上陽一	H25.3.15	H29.5.26	2013-052876	6145596
45	酸化セリウム砥粒再生方法	特許	赤上陽一、久住孝幸	H24.3.21	H28.5.27	2012-063494	5938589
46	電界洗浄方法、電界免疫組織染色方法、電界洗浄装置及び、電界免疫組織染色装置	特許	赤上陽一、加賀谷昌美、中村竜太、池田洋	H26.1.22	H27.6.5	2014-009634	5754520
47	電界攪拌用はっ水フレーム	特許	赤上陽一、加賀谷昌美、中村竜太、池田洋	H26.1.22	H26.12.5	2014-009629	5655180
48	切削工具仕上げ装置および切削工具仕上げ方法	特許	赤上陽一	H26.1.15	H29.11.24	2014-004940	6244573
49	自動電界免疫組織染色装置	特許	赤上陽一、加賀谷昌美、中村竜太、池田洋	H26.2.20	H27.2.20	2014-030179	5696300
50	ドリル及び穿孔の形成方法	特許	斉藤耕治、加藤勝	H25.11.7	H30.8.31	PCT/JP2013/ 080126 2014-545750	6393620
51	ドリル及び穿孔の形成方法	外国特許	斉藤耕治、加藤勝	H25.11.7	R2.3.4	PCT/JP2013/ 080126 13843029.3	EP2918361 B1
52	ドリル及び穿孔の形成方法	外国特許	斉藤耕治、加藤勝	H25.11.7	H30.1.12	PCT/JP2013/ 080126 201380003276.9	ZL2013 80003276.9
53	ドリル及び穿孔の形成方法	外国特許	斉藤耕治、加藤勝	H25.11.7	H28.10.25	PCT/JP2013/ 080126 14/229096	US9475128 B2
54	並進機構を用いたアクチュエータの減衰方法およびアクチュエータ	外国特許	森英季	H26.1.23	H28.11.15	14/162562	US9496478 B2
55	自動電界免疫組織染色装置及び、自動電界免疫組織染色方法	外国特許	赤上陽一、加賀谷昌美、中村竜太、池田洋	H26.2.20	H29.12.5	14/185533	US9835619 B2
56	研磨材および研磨方法	特許	赤上陽一、久住孝幸、中村竜太	H26.3.18	H30.5.25	2014-054845	6340497
57	迅速かつ高感度な多重免疫染色法	特許	赤上陽一、中村竜太	H26.5.16	H30.10.26	2014-102883	6421369
58	検知装置及び摘出部位載置容器	特許	丹健二	H27.1.22	H30.8.31	2015-010003	6392132
59	水素水生成器	特許	木谷貴則、黒澤孝裕、山川清志	H27.1.28	H28.9.30	2015-014852	6012782

No.	名称	権利の別	発明者	出願日	登録日	出願番号	登録番号
60	細胞内生体分子の検出に用いる標準試料及び細胞内生体分子の検出方法	特許	赤上陽一、中村竜太	H27.2.3	H28.8.26	2015-019566	5993967
61	培養細胞を用いた標準試料及びその製造方法	特許	赤上陽一、中村竜太	H27.2.5	H28.7.22	2015-021657	5972412
62	電界攪拌用電極及びこれを用いた電界攪拌方法	特許	赤上陽一、中村竜太	H27.2.6	H27.10.23	2015-022163	5825618
63	微小液滴を形成する反応デバイス及びこれを用いた電界攪拌方法	特許	赤上陽一、中村竜太	H27.2.6	H27.11.20	2015-022575	5839526
64	液滴形成用シャーレ及びこれを用いた電界攪拌方法	特許	赤上陽一、中村竜太	H27.2.6	H27.12.25	2015-022721	5857309
65	ゼータ電位制御法を用いた処理方法	特許	赤上陽一、中村竜太、久住孝幸、池田洋、佐藤安弘	H27.2.12	H28.2.26	2015-025880	5891320
66	熱電変換素子、発電デバイス	特許	伊勢和幸	H27.5.21	H31.4.19	2015-103327	6513476
67	交流電磁石	特許	山川清志	H27.12.10	R1.10.18	2015-241610	6601799
68	電界攪拌を用いた生体分子の迅速検出法	特許	赤上陽一、中村竜太	H28.2.5	H28.10.21	2016-020839	6026027
69	硬質磁性材料	特許	新宅一彦	H28.3.8	R2.7.14	2016-044907	6734578
70	光検知式水素ガスセンサ	特許	山根治起、高橋慎吾	H28.3.18	R2.1.17	2016-055934	6647589
71	迅速なハイブリダイゼーション方法	特許	赤上陽一、中村竜太	H29.2.27	H30.2.2	2017-034426	6281852
72	電界攪拌方法及び電界攪拌用キャップカバー	特許	赤上陽一、中村竜太	H29.7.11	R2.10.21	2017-135498	6781873
73	液滴移動装置及び液滴の移動方法	特許	赤上陽一、中村竜太	H29.10.12	H30.6.22	2017-198243	6354114
74	繊維構造物を埋設した樹脂成形品の製造方法及び樹脂成形品	特許を受ける権利	野辺理恵	H29.10.24		2017-205656	
75	反応デバイス、電界攪拌装置、及び検出方法	特許	赤上陽一、中村竜太	H30.2.19	H30.10.26	2018-026697	6422068
76	旋光度測定装置	特許	山根治起	H30.3.2	H30.7.13	2018-037602	6368880
77	WC-Si3N4系複合セラミックス及びその製造方法	特許を受ける権利	杉山重彰、関根崇	H30.10.26		2018-201820	
78	電界攪拌を利用した透析・浸透方法、及び透析・浸透装置	特許を受ける権利	赤上陽一、中村竜太	H31.1.31		2019-015579	
79	プラズマ発生装置	特許を受ける権利	丹健二	H31.2.26		2019-032595	
80	液中プラズマ発生装置	特許を受ける権利	丹健二	H31.2.26		2019-032596	
81	ガス検知装置	特許を受ける権利	山根治起	H31.3.29		2019-067141	
82	切断方法及び切断装置	特許を受ける権利	久住孝幸、赤上陽一、越後谷正見	R1.12.17		PCT/JP2019/049487 2020-563119	
83	排尿検知装置	特許を受ける権利	小笠原雄二、近藤康夫、丹健二、伊藤亮96、大竹匡	R2.2.17		2020-023942	
84	金属製ナノコイルの製造方法	特許を受ける権利	新宅一彦	R2.2.21		2020-028264	
85	打撃装置および固有周波数測定装置	特許を受ける権利	木村光彦	H30.1.26		2018-011638	
86	超音波振動装置およびホーン	特許を受ける権利	荒川亮、森英季	R2.3.24		2020-052499	
87	熱電変換素子及び熱電変換モジュール	特許を受ける権利	伊勢和幸	R2.6.12		2020-102495	
88	薄膜製造方法、薄膜製造装置、センサの製造方法	特許を受ける権利	杉山重彰、菅原靖、関根崇	R2.7.21		2020-124382	
89	光検知式化学センサ	特許を受ける権利	山根治起、山川清志、高橋慎吾	R2.8.4		2020-132418	
90	打撃装置および固有周波数測定装置	特許を受ける権利 (外国特許)	木村光彦	H30.12.12		18212070.9	

No.	名称	権利の別	発明者	出願日	登録日	出願番号	登録番号
91	複合Cu材、これを含む電子部品または実装基板、電子部品実装基板、複合Cu材の製造方法、および、接合体の製造方法	特許を受ける権利	黒沢憲吾	R2.9.3		2020-148313	
92	打撃装置および固有周波数測定装置	特許を受ける権利 (外国特許)	木村光彦	H31.1.16		16/248809	
93	木材切断端面直径の撮像計測方法及び装置	特許を受ける権利	伊藤亮97、佐々木大三、小笠原雄二	R2.12.25		2020-216137	
94	打撃装置および固有周波数測定装置	特許を受ける権利 (外国特許)	木村光彦	H30.11.16		20181136115.7	
95	異種金属接合体およびその製造方法	特許を受ける権利	鈴木淑男	R3.3.23		2021-049102	

3. 各研究会の概要

令和2年度

<p>○秋田県非破壊検査技術研究会</p> <p>非破壊検査、及び溶接・接合に関する技術水準の向上普及を図り、工業の発展に寄与することを目的とし、講演会、講習会、研究成果発表会、視察会、情報交換会などを実施。</p> <p>代表者：佐々喜興業（株） 佐々木 一喜</p> <p>会員：企業45社、大学・支援機関等6機関8名</p> <p>事務局：素形材開発部 木村 光彦</p>
<p>○秋田県高分子材料研究会</p> <p>プラスチック成形加工技術、金型技術、高分子材料等に関する生産技術向上を図るとともに、会員相互の研鑽を目的として、研究開発報告会、先端技術講演会、射出成形取扱講習会、金型講習会、先進地見学会、情報交換会、企業表彰などを実施している。</p> <p>代表者：（株）フルヤモールド 古谷 武美</p> <p>会員：企業25社、大学・支援機関等6機関7名</p> <p>事務局：素形材開発部 工藤 素</p>
<p>○秋田県表面処理技術研究会</p> <p>表面処理（電気めっき、無電解めっき、溶融亜鉛めっきなど）に関する技術の向上をはかるとともに会員相互の研鑽と融和をはかるとを目的とし、講演会、講習会、研究成果発表会、視察会、情報交換会などを実施。</p> <p>代表者：太平化成工業（株） 加賀 孝義</p> <p>会員：企業20社、大学・支援機関等4機関5名</p> <p>事務局：先端機能素子開発部 菅原 靖</p>
<p>○秋田県生産技術研究会</p> <p>工業の生産技術に関する研修、試験研究等を通して、新技術の開発、技術力の向上、人材養成を図るとともに産・学・官の連携強化等により本県工業の発展に資することを目的とし、（1）分科会方式による新技術の開発、共同研究の実施、（2）技術講習会、講演会、研修会の開催、（3）研究成果・事例発表会、企業見学会等の開催、（4）技術交流および技術情報の交換などを実施。</p> <p>代表者：（株）三栄機械 佐藤 淳</p> <p>会員：企業50社、大学・支援機関等7機関9名</p> <p>事務局：先進プロセス開発部 加藤 勝</p>
<p>○北東北ナノ・メディカルクラスター研究会</p> <p>精密加工技術・界面制御技術・医療技術を融合させた次世代医療システムづくりの進展を目指し、北東北の産業創出に貢献することを目的とする。</p> <p>代表者：秋田大学医学部附属病院 南條 博</p> <p>会員：企業10社、大学・支援機関等14機関</p> <p>事務局：先進プロセス開発部 中村 竜太</p>
<p>○秋田県硬質工具材料研究会</p> <p>産学官が協力して硬質工具材料技術に関する技術交流を図り、硬質工具材料技術を利用した新材料開発や新製品開発などを目指すことで、この分野における技術の高度化を図るとともに、会員相互の啓発と親睦を図り、本県の工業の発展に資することを目的とする。</p> <p>代表者：秋田大学大学院 泰松 斉</p> <p>会員：企業5社、大学・支援機関等2機関6名</p> <p>事務局：先端機能素子開発部 関根 崇</p>
<p>○次世代ひかり産業技術研究会</p> <p>県内で活動する企業による次世代ひかりデバイス及びその周辺技術（以下、「ひかりデバイス等」という。）の用途開発や製品開発又はマーケティング戦略構築等に資するため、企業支援機関、大学等と連携し、ひかりデバイス等の技術や市場動向に関する情報の収集や市場進出に向けた課題の検討等を行うほか、会員相互の情報交換・マッチングを図ることを目的とする。</p> <p>代表者：秋田大学大学院 河村 希典</p> <p>会員：企業31社、大学・支援機関等7機関56名</p> <p>事務局：先端機能素子開発部 梁瀬 智</p>
<p>○高エネルギー加速器技術研究会</p> <p>国際リニアコライダーや次世代放射光施設を始めとする高エネルギー加速器産業への部品調達などの産業参入や施設利活用の高度化などを目指すことにより、この分野の技術向上を図るとともに、会員相互の啓発と親睦を図り、本県の工業の発展に資することを目的とし、（1）技術講習会および講演会の開催、（2）技術情報の交換および加速器施設の視察などを実施。</p> <p>代表者：秋田化学工業（株） 丹野 恭行</p> <p>会員：企業18社、大学・支援機関等6機関16名</p> <p>事務局：電子光応用開発部 近藤 祐治</p>

○あきた AI・IoT 技術互助会**代表者：(株) 三栄機械 齊藤 民一**

AI や IoT を活用した高効率な企業活動を実現するために必要となる技術を、研修や試験研究、会員相互の技術支援（互助）を通して習得・実装・普及を図ることにより、少子高齢化や人材不足の課題を乗り越えつつ、新たな産業創出と本県の発展に資することを目的とする。

会員：企業等 36名**事務局：電子光応用開発部 佐々木 信也****○秋田県ロボット技術研究会****代表者：アキモク鉄工（株） 花下 智之**

県内企業にロボティクス技術の活用や自動化推進を促すため、（1）ロボット及びその周辺技術に関する情報提供および情報交換、（2）勉強会や技術講演会、（3）企業見学会、（4）産学官の技術交流を通じた新技術開発 等を実施し、ロボティクス分野の高度化を図るとともに本県の工業の発展に資することを目的とする。

会員：企業32社、大学・支援機関等11機関13名**事務局：先進プロセス開発部 伊藤 亮**

VI 当センターのご利用について

1. 秋田県産業技術センターの所在とアクセス、ご利用案内

1-1 所在

秋田県産業技術センター 本館

住所 〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4番地の11

連絡先 Tel 018-862-3414 Fax 018-865-3949

秋田県産業技術センター 高度技術研究館

住所 〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4番地の21

連絡先 Tel 018-862-3414 Fax 018-866-5803

ホームページ

<http://www.aitc.pref.akita.jp/>



1-2 公共交通機関によるアクセス

- ◎バス 秋田中央交通 秋田駅西口発『県立プール』線
本館：『工業技術センター前』停留所下車※
高度技術研究館：『県立プール前』停留所下車※
※両建屋間は徒歩2分ほど離れていますのでご注意ください。

- ◎タクシー 秋田駅より約7キロ、20分。運賃3,000円程度

1-3 ご利用案内

秋田県産業技術センターでは、秋田県産業の活性化と持続的な発展を目指し、研究業務のほかにも、県内企業の皆様のためのさまざまな活動を行っております。技術相談、共同研究、受託研究、人材育成、設備利用など、各種のサポートメニューをご用意し、県内企業をはじめとする皆様のご利用をお待ちしております。

詳細については以降をご確認いただき、各担当窓口までご相談ください。ご不明な点などもお気軽にお問い合わせください。

(1) ご相談窓口について

はじめて当センターをご利用される方、新たなご相談のある方は、下記電話へご連絡ください。また当センターホームページのお問い合わせのページからは、メールによるご連絡も可能です。

TEL 018-866-5800

ホームページ <http://www.aitc.pref.akita.jp/>

継続してご利用されている方は、引き続き、担当の研究員へ直接ご連絡ください。

◎共同研究

- ・企業の皆様と当センターが共同で研究開発に取り組みます。
 - ・秋田県産業技術センターで使用する消耗経費をご負担いただきます。
 - ・共同研究契約を締結していただきます。秘密保持契約も可能です。
- 詳しくは共同研究推進部までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

◎研修

- ・企業の皆様の技術力向上や新技術の習得のために研修制度を用意しております。
- ・研修費用は無料ですが、必要な消耗品についてはご負担願います。
- ・学生の皆さんのインターンシップも受入可能です。

◎設備機器利用

- ・試作加工、分析評価等に利用できる当センター設備機器を開放しております（有料）。
 - ・使用料のほか、必要な消耗品についてはご利用者様にご負担いただきます。
 - ・設備機器の使用方法については、当センター研究員がサポートします。
- 詳しくは次項「設備機器利用について」をご参照ください。

◎研究会の紹介

- ・当センターが活動を支援している研究会を紹介します。
- ・講演会、講習会、研究発表会、情報交換会、工場見学会などを開催しております。
- ・企業間連携、産学官連携の場としてご活用ください。

(2) 設備機器利用について

秋田県産業技術センターでは、研修会や会議等に利用できる当センターの研修室や会議室を、また試作、加工、分析評価等に利用できる当センターに設置されている設備機器の一部を、有料で開放しています。機器設備のご利用案内と、ご利用いただける機器の一覧を収録してありますのでご参照ください。なお、これら設備機器につきましては、ご利用の可否、ご利用条件、料金などに変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

2. 秋田県産業技術センター施設・設備利用のご案内

秋田県産業技術センターでは、試験研究、技術支援・相談、技術者養成、研究会活動、研修会・講習会の開催、技術情報の提供などの業務を行っております。

当センターには、県内企業をはじめ外部の方に施設や設備機器を次のとおり開放しております。

ご利用の留意事項

(1) 利用者

特に制限はありません。

(2) 利用対象施設、設備機器及び使用料金

「施設及び設備使用料」に記載しているとおりです。

(3) 利用日時

原則として、当センターの休業日を除く午前9時から午後5時までです。

(4) 利用・申し込み方法

あらかじめ電話等により、対象設備、利用日時等をご連絡の上、当日まで申請手続きが必要です。使用が可能な場合は、許可書を交付します。

(5) 使用方法の指導

設備機器の使用方法については、必要に応じて当センター職員が指導します。

(6) 支払方法

当センターで発行する納入通知書により、指定金融機関に納付することになっています。

(7) ご利用にあたっての順守事項

- ◎ 会議室、講堂、展示室の使用に際しての机、椅子の準備及び原状回復は、使用者の責任において行うことになっています。
- ◎ 茶器は無償で貸し付けしますが、消耗品は持ち込みとなるほか、後片づけは使用者の責任において行って下さい。
- ◎ 敷地内（駐車場を含む）は、全面禁煙です。
- ◎ 設備機器のご利用にあたっては、原則として危険物及び有害物質の持ち込みを禁止いたします。
- ◎ 当センターの施設及び設備機器をき損した場合は、直ちに届け出願います。
故意または過失によると認められる場合には、損害賠償の責任が生じることとなりますので注意してご利用下さい。

(8) 申込・照会先

〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4番地の11

秋田県産業技術センター

施設利用

総務管理部 TEL 018-862-3414 FAX 018-865-3949

設備利用等の相談窓口

共同研究推進部 TEL 018-866-5800 FAX 018-866-5803

施設使用料及び設備使用料

1. 開放研究室

開放研究室には、備品としてOAテーブル、OAチェア、キャビネット、ロッカー、作業台などが備え付けられており、LANの端子が設けられておりますので、コンピュータを持ち込むことにより、電子メール等を利用できます。

(1) 本館

区分	面積 (m ²)	室数	使用料金 (円/月)
開放研究室A	59	1	71,130
開放研究室B	46	6	67,890
開放研究室C	40	2	45,260

(2) 高度技術研究館

区分	面積 (m ²)	室数	使用料金 (円/月)
高機能開放研究室	61.44	5	99,630

2. 講堂、研修室、会議室、展示室

(1) 本館

区 分	使 用 料			収容人数
	9:00-12:00	13:00-17:00	9:00-17:00	
講 堂	3,600円	4,800円	8,400円	100人
研修室B	1,110円	1,480円	2,590円	20人
展示室	(1日) 1,360円			—

また、次の付属備品が使用できますので、施設の使用申込の段階でお申し込み下さい。使用料はかかりません。

液晶プロジェクタ、スクリーン、ホワイトボード、ワイヤレスマイク

(2) 高度技術研究館

区分	使 用 料			収容人数
	9:00-12:00	13:00-17:00	9:00-17:00	
視聴覚研修室	9,900円	13,200円	23,100円	100人
研修室A	3,600円	4,800円	8,400円	24人

3. 機械設備の使用料について

次頁以降に示します。

(注1) 使用時間が1時間未満である時、または当該時間に1時間未満の端数がある時は、1時間として計算した使用料です。

(注2) 施設及び設備使用料には、消費税が含まれています。

(注3) 付属設備の使用料が追加される場合があります。

秋田県産業技術センター機器設備一覧

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
1	放射線(α 線、 β 線、 γ 線)測定器	日立アロカメディカル株式会社	TCS-362,TCS-172B,ICS-323C	H23	110	遠田
2	高周波3次元電磁界シュミレータ	アンソフト	HFSSV・10・0	H17	970	熊谷
3	PC制御画像認識塗布システム	武蔵エンジニアリング株式会社	SHOTMASTER SM300DSS-3A+IMAGE MASTER 350PCSmart	H28	220	熊谷
4	レーザーカッター	エピログ社	Epilog Mini 24	H29	270	熊谷
5	非接触ジェットディスペンサー	武蔵エンジニアリング株式会社	AeroJet	R02	100	熊谷
6	シグナルジェネレータ	アジレントテクノロジー	E4426B	H14	120	丹
7	低雑音振幅器	MITEQ	NSP2000-P	H17	110	丹
8	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	NF 3660	H04	440	丹
9	非接触三次元デジタイザー	Steinbichler	COMET	H21	1,990	黒沢
10	電源ノイズ測定器	(株)TFF(テクトロニクス)	MDo4104-6	H23	250	佐々木(大)
11	全光束測定システム	オーシャンフォトニクス	OP-FLUX-76-CA	H23	2,410	梁瀬
12	精密騒音計	リオン(株)	NL-52	H25	100	内田(勝)
13	超高精度三次元測定器	Panasonic	UA3P-300	H20	2,930	久住
14	非接触式表面性状評価装置	Zygo	NewView6300	H19	1,150	久住
15	非接触式フィゾー干渉計	Zygo	GPI XP/D	H19	580	久住
16	4インチ光学原器	Zygo	TS f/0.65, f/1.5, f/3.3	H21	300	久住
17	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	ZYGO	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	H23	140	久住
18	総合型金属顕微鏡	オリンパス(株)	DSX500,DSX100	H25	540	黒沢
19	CNC3次元測定機	カールツァイス(株)	PRISMO 5 HTG-S	H07	470	加藤
20	真円度測定機	ランクテラーホブソン	タリロンド262型	H08	110	加藤
21	CNC三次元測定機用データ処理装置	(株)東京精密	Calypsoシステム	H18	850	加藤
22	超高倍率3次元複合顕微鏡	島津製作所	ナノサーチ顕微鏡SFT-3500ほか	H17	1,680	加藤
23	表面粗さ測定機	(株)東京精密	サーフム3000A-3DF-DX-S	H13	120	加藤
24	高精度CNC画像測定機	(株)ニコンインステック	NEXIV VMZ-R6555	H27	800	加藤
25	ハイエンド3次元CAD/CAMシステム	PTC社	Pro/ENGINEER Wildfire 4	H10	110	内田(富)
26	3D鋳型積層造形装置	シーメット社	SCM-10	H27	4,950	内田(富)
27	3次元X線CTシステム	(株)東芝	TOSCANER-32300 μ FD	H28	2,850	内田(富)
28	鋳造CAEシステム	クオリカ	JSCAST	H29	580	内田(富)
29	3Dハイエンドプリンターシステム	ストラタシス社	J750	R01	8,850	内田(富)
30	3次元CADシステム	DASSAULT SYSTEMS	Solidworks	H28	500	黒沢
31	3D形状計測システム	東京貿易テクノシステム	VMC7000M	R02	3,000	黒沢
32	再資源化焼結炉	アドバンテック東洋(株)	KS-1703型	H07	160	遠田
33	管状炉	タナカテック	MPH-6VGS	H15	520	遠田
34	炭化賦活炉	(株)ウエーブ二十一	炭化賦活炉 T-2000L	H16	1,210	遠田
35	ナノバブル評価装置	マイクロトラック・ベル株式会社	ZetaView-PMX100SP	H29	410	遠田
36	空圧落下衝撃試験装置	ボックス・ブラウン(株)	SM-110-MP型	H03	110	近藤(康)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
37	絶縁耐圧試験器	日置電機(株)		H14	110	近藤(康)
38	差動プローブセット	ソニー・テクトロニクス	P6330・P5210・TCP202S	H14	110	佐々木(信)
39	光テストシステム装置	横河電機	AQ2200	H17	710	佐々木(信)
40	ベクトルシグナルジェネレータ	アジレント	V2920A	H21	310	佐々木(信)
41	ミックスドシグナルオシロスコープ	日本テクトロニクス	MSO4104	H20	110	佐々木(信)
42	ソフトウェア品質評価試験システム	株式会社ハートランドデータ	DT10 STD Value IVセット	H26	260	佐々木(信)
43	計測制御ソフトウェア開発システム	National Instruments(株)	LabVIEW 2010プロフェッショナル開発システム	H23	110	佐々木(大)
44	プレジジョンパワーアナライザ	横河電機(株)	WT3000	H23	180	佐々木(大)
45	ネットワーク・アナライザ・システム	アジレント・テクノロジー(株)	E8364A	H14	1,260	黒澤
46	総合熱分析装置	セイコー電子工業(株)	EXSTAR6000	H08	890	関根
47	電気伝導率・熱電率測定装置	真空理工(株)	ZEM/PEM-1型	H09	1,410	関根
48	熱膨張測定装置	理学電機	Thermo Plus 2	H15	470	関根
49	熱特性測定装置	NETZSCH	LFA457-A21 MicroFlash	H21	1,210	菅原
50	高温動弾性率測定装置	東芝タンガロイ(株)	UMS-HL	H10	3,410	関根
51	電界放射走査電子顕微鏡	日立製作所	S-4500	H08	620	菅原
52	S-4500用オートステージ	日立製作所	S-8432型	H12	110	菅原
53	電子プローブマイクロアナライザ	日本電子(株)	JXA-8200ほか	H13	1,680	菅原
54	圧縮成形機	東洋精機(株)	試験用加硫プレス 30ton f	S58	280	工藤
55	プラスチック衝撃試験機	上島製作所	シャルピー-JIS7111	S58	110	工藤
56	3D射出成形シミュレーションシステム	富士通(株)	CELSIUS W480-NTM	H23	1,150	工藤
57	示差走査熱量計	セイコーインスツルメンツ株式会社	X-DSC7000	H23	630	工藤
58	プラスチック万能材料試験機(CFRP用)	インストロン(株)	5967型	H24	940	工藤
59	マルチインテグサ	(株)東洋精機製作所	型式G-01	H25	250	工藤
60	真空加熱プレス装置	井元製作所	1824型	H19	110	菅原
61	電子天秤	ザルトリウス(株)	MC210S	H10	110	工藤
62	3次元CAD/CAMシステム	CNC Software	Mastercam他	H19	1,620	加藤
63	色彩色差計	日本電色工業(株)	SQ-2000	H12	290	工藤
64	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光(株)	IRT-7000	H21	840	工藤
65	粘弾性測定装置	Anton Paar社	MCR302	H26	1,120	工藤
66	低高抵抗率測定システム	(株)三菱アナリク	ロレスタMCP-T610,ハイレスタMCP-HT800	H26	210	野辺
67	プラスチック自動比重計	東洋精機製作所	DSG-1	H28	100	野辺
68	デジタル硬度計	テクロック	GSD-1	H29	100	野辺
69	電動式塗工機	(株)小平製作所	YOA-B型	H18	110	菅原
70	熱分析装置	株式会社リガク	TG-DTA8122 / TMA8311(-S) / TMA8311(-H) / DSC8271 / DSCvesta	R02	1,120	関根
71	小型電気炉	(株)セイシン企業	PART-3	H02	260	菅原
72	セミビッカース硬度計	マツザワ	PVT-7S	H21	430	関根
73	超硬製転動ミル用容器	(株)伊藤製作所		H20	110	関根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
74	マイクロビッカーズ硬度計	(株)マツザワ	AMT-X7FS-B	H28	270	関根
75	X線応力測定装置	(株)マックサイエンス	MXP3AHP	H07	1,730	黒沢
76	原子吸光分光分析装置	日本ジャーレルアッシュ	SOLAAR M-6	H15	1,100	工藤
77	炭素・硫黄分析装置	LECO社	CS-200型	H13	890	工藤
78	高周波プラズマ発光分光分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社	iCAP6300 Duo	H23	3,670	工藤
79	スクラッチ試験機	新東科学(株)	TYPE.22H	H06	400	瀧田
80	微小硬さ試験機	(株)フィッシャー・インストルメンツ	H-100	H14	490	瀧田
81	X線残留応力測定装置	パルステック工業株式会社	m-X360s	R02	750	瀧田
82	X線回折装置	リガク	RINT-2500	H09	720	菅原
83	低温灰化装置	ヤマト化学	PDC-210	H15	680	工藤
84	電気マuffle炉	アドバンテック東洋	FUS612PA	H15	360	工藤
85	ドラフトチャンパー	(株)ダルトン	DFB11-DFC14,DFD31	H27	730	工藤
86	精密旋盤	池具鉄工	D-20型	S47	260	加藤
87	ドリル研削盤	(株)藤田製作所	DG36A形	S55	220	加藤
88	NCフライス盤	遠州製作(株)	TNC 6MB付	S57	1,730	加藤
89	コンターマシン	アマダ	V-400	S47	110	加藤
90	直立ボール盤	(株)吉田製作所	YUD600	S47	110	加藤
91	卓上ボール盤	吉田鉄工所	YBD-420B	S46	110	加藤
92	超精密成形形状研削盤	ナガセインテグレックス	SGC-630S4AK-Pcnc	H22	3,670	加藤
93	ミスト冷風供給装置	(株)荏原製作所	アイミストZELSR0401	H12	140	加藤
94	油圧式強力高速弓鋸盤	津根マシーンツール	PSB-350U	H12	280	加藤
95	ワイヤーカット放電加工機	(株)ソディック	AQ360L	H18	1,010	加藤
96	5軸制御立形マシニングセンタ	オークマ(株)	MU-400V II 型	H26	2,740	加藤
97	プラスチック粉碎機	ホーライ	VC3-360	H12	240	工藤
98	鋳型焼成雰囲気炉	日新化熱工業(株)	EBS-9(改)	H10	1,310	内田(富)
99	チタン用精密鋳造機	吉田キャスト	YSE-100	H28	1,270	内田(富)
100	複合サイクル腐食試験機	スガ試験機	CYP-90	H20	290	菅原
101	多目的高温炉	富士電波工業	ハイマルチ5000	H08	1,040	関根
102	交直両用TIG溶接機	(株)ダイヘン	AVP-3000P	H13	740	黒沢
103	真空チャンパー	日本精機	φ500×H250mm(内寸)材質:SUS304	H14	280	黒沢
104	レーザ加工装置	レーザライン	LDM3000-60	H29	1,900	黒沢
105	プレス付真空熱処理装置	東京真空(株)	PRESS-VAC-2	H03	580	瀧田
106	冷間等方加圧成形装置	アプライドパワー・ジャパン(株)	CIP-50-2000	H07	310	関根
107	放電プラズマ焼結装置	住友石炭鉱業(株)	SPS-2080	H08	5,400	関根
108	高速精密切断装置	平和テクニカ(株)	HS-100G II	H29	300	関根
109	極間式磁気探傷機	日本工機	BY-1	S43	110	黒沢
110	超音波映像装置	日立エンジニアリング・アンド・サービス	FS200 II	H22	1,780	黒沢
111	磁気探傷機	(株)島津製作所	PRA-80型	S46	230	黒沢

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
112	超音波探傷器	東京計器	SM80型	S53	510	黒沢
113	X線透過検査装置	理学電気工業(株)	300EG-B2L型	S55	1,000	黒沢
114	JSNDI仕様デジタル超音波探傷器	GEインスペクション・テクノロジーズ・ジャパン(株)	USM35X JE	H23	160	黒沢
115	3Dプリンターシステム	STRATASAS	FORTUS250mc	H25	1,120	黒沢
116	有限要素解析用計算システム	エムエスシーソフトウェア(株)	Marc2014AIT	H26	1,620	伊藤(97)
117	双腕型協働ロボット	(株)川田工業	Nextage	R01	810	伊藤(97)
118	協働ロボット遠隔操作システム	ユニバーサルロボット/アストラテック	UR5e/V-Sido Webconnect	R02	540	伊藤(97)
119	ロックウェル硬さ試験機	(株)アカシ	ATK-F1000	H07	190	内田(富)
120	ビッカース硬度計	(株)アカシ	AVK-C2500	H04	110	内田(富)
121	XY自動テーブル付硬度計	明石製作所	MS-4	S60	250	内田(富)
122	電解研磨装置	ストルアス社	ポレクトロール	H09	230	黒沢
123	試料研磨琢磨機	ビューラー	エコメット4000	H20	720	黒沢
124	セラミックス研磨装置	丸本ストラウス(株)	アブラミン	H10	2,670	関根
125	セラミックス自動精密切断機	丸本ストラウス(株)	アキュトム50	H11	400	関根
126	万能材料試験機	Instron	5985	H22	2,460	黒沢
127	小型造粒機	日本アイリッヒ(株)	アイリッヒ逆流式高速混合機RVO2型	H02	200	菅原
128	ボールミル	日陶科学	架台二連式AN-3S無段変速28~100bpm	H01	110	菅原
129	中型電気炉	(株)モトヤマ	SH-3045E	H10	900	菅原
130	遊星回転ボールミル	(有)伊藤製作所	LA-PO412	H08	210	関根
131	アトライタ	日本コークス工業(株)	MAISE-X	H25	350	関根
132	真空乾燥用ミキサ	日本コークス工業(株)	FMミキサ、FM10C/I-X型	H26	910	関根
133	真空溶解炉	富士電波工業(株)	FVPM-10型	H07	1,890	内田(富)
134	ニューマブラスター	(株)不二製作所	FDQ-4S	S57	300	内田(富)
135	動的ひずみ解析装置	(株)共和電業	EDX-1500A-16AC	H10	110	内田(富)
136	エアブラストマシン	(株)不二製作所	SGF-3(A)	R02	500	内田(富)
137	エアブラストマシン	(株)不二製作所	SGF-3(A)	R02	500	内田(富)
138	発光分析装置	(株)SPECTRO Analytical	SPECTROLAB M	H14	1,310	黒沢
139	シャルピ衝撃試験機	(株)島津製作所	30kgm型	S54	140	内田(富)
140	万能試験機	島津製作所	UH-F300kNI	H19	700	瀧田
141	スガ摩耗試験機	スガ試験機(株)	NUS-ISO-3型	H01	170	関根
142	摩耗試験機	(株)エー・アンド・ディ	EFM-3-EM	H09	420	関根
143	標準試験片作製金型	AXXICON社	AIM Mould System	H13	230	工藤
144	ベント式射出成形機	日精樹脂工業株式会社	NEX110-IV-12EG φ32ベント式可塑化ユニット	R02	1,780	野辺
145	押出機	(株)テクノベル	KZW25TW-60MG-NH(1200)スク径25φ	H16	1,620	工藤
146	集塵機	アマノ(株)	PIE45	H18	490	工藤
147	樹脂乾燥機	アドバンテック東洋	DRL823WA	H16	220	工藤
148	砥粒分散用超音波発生器	トミー精工	UD-201(S)	H13	110	久住

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
149	平坦度測定装置	(株)ニデック	FT-900(ウエハ用)	H25	1,270	久住
150	磁束密度測定装置	F.W.BELL	9550	H09	130	丹
151	電界制御装置	トレック・ジャパン(株)	MODEL20/20B	H10	110	久住
152	自動研磨ヘッド	ビューラー	オートメット2000 60-1970	H20	110	久住
153	除振台	明立精機	AYA-1809K4	H21	110	久住
154	レーザー変位計	キーエンス	LC-2400	H14	110	久住
155	電界砥粒制御用小型片面研磨装置	ビューラー	エコメット250/オートメット250	H28	160	久住
156	電界砥粒制御用多機能ワイヤーソー	(株)タカトリ	WSD-K2	H30	1,010	久住
157	電源装置	トレックジャパン(株)	MODEL609D-6	H07	190	久住
158	15MHzファンクションウェーブジェネレータ	日本ヒューレットパッカー	33120A	H11	110	久住
159	オシロスコープ	日本ヒューレットパッカー	HP-54645A	H11	110	久住
160	材料物性測定装置	東陽テクニカ	1260-MAS(ソーラートロン)	H18	700	久住
161	ゼータ電位測定装置	Sysmex	Nano Z	H19	340	久住
162	誘電率測定用サンプルホルダー	東陽テクニカ	SH2-Z	H25	100	久住
163	動的光散乱式測定装置	(株)Malvern	ゼータナノサイザー ナノZSP	H26	810	久住
164	安全キャビネット	エアーテック	BHC-1006 II A/B3	H20	110	中村
165	核酸増幅システム	三洋電機バイオメデिका(株)	MDF-192	H17	310	中村
166	蛍光顕微鏡	ニコン	E400-RFL 1	H15	200	中村
167	サーマルサイクラー	Bio-Rad	T100	H27	100	中村
168	プレートリーダー	Bio-Rad	iMark PCシステム	H27	100	中村
169	蛍光式光ファイバー温度計	安立計器	FL-2000	H28	100	中村
170	フローサイトメーター	ベックマン・コールター社	CytoFLEX 3レーザー13カラー	H28	1,220	中村
171	蛍光顕微鏡	(株)キーエンス	BZ-X800	R02	250	中村
172	研磨装置	不二越機械工業(株)	SLM-140	H22	490	久住
173	片面研磨装置	不二越機械工業(株)	SLM-140改	H25	560	久住
174	高速引張試験機	島津製作所	HITS-T10	H21	2,410	黒沢
175	落錘衝撃試験機	INSTRON	9205HV	H21	1,470	黒沢
176	材料試験高速解析システム	(株)フォトロン	FASTCAM SA-X	H24	800	黒沢
177	減圧除湿乾燥機	カワタ(株)	DV-30	H26	250	野辺
178	高転写成形用急加熱冷却金型システム	山下電気(株)	超臨界発泡射出成形機用金型	H26	1,110	野辺
179	立形マシニングセンタ用集塵防塵装置	アマノ	PIE-30SD	H22	780	加藤
180	立形マシニングセンタ	ファナック	α -T14iD	H16	470	加藤
181	複合材料圧縮成形装置	(有)郷製作所	MBO05-GMS	H27	1,410	工藤
182	複合材硬化成形用オートクレーブ	株式会社 羽生田鉄工所	ϕ 850 x 1500L	H21	1,470	藤嶋
183	複合材料切断機	(株)丸東製作所	AC-300CF	H22	580	藤嶋
184	フラットベット切断機	(株)ミマキエンジニアリング	CF2-1215RC-S	H25	760	藤嶋
185	超臨界発泡射出成形機	日精樹脂工業株式会社	NEX180III 25E	H24	3,040	野辺
186	ロボットシミュレーションシステム	(株)シーエムエス	Visual Components 3D Automate	R01	730	伊藤(97)
187	ワイヤーボンダー	TPT	モデル16	H16	270	丹

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
188	バイポーラ電源	松定プレジジョン	POEF60-20	H27	100	丹
189	プリント基板加工システム	日本LPKF株式会社	Protomat C100HF	H16	460	佐々木(大)
190	直流安定化電源	菊水電子工業(株)	PAT80-100T WITH USB	H27	180	佐々木(大)
191	電子負荷装置	菊水電子(株)	PLZ1004WH	H27	100	佐々木(大)
192	冷熱衝撃装置	エスベック(株)	TSA-73ES-W	R01	700	伊藤(96)
193	雷サージ試験システム	(株)ノイズ研究所	LSS-15AX-C1/S	H13	110	近藤(康)
194	耐候性試験機	岩崎電気(株)	SUV-W161	H25	1,540	近藤(康)
195	グローワイヤー試験機	Physics tecnic Labor	TA03.35(付属チャンバBT-07)	H25	320	近藤(康)
196	雑音総合評価試験機	(株)ノイズ研究所	MODEL EMC-5000S	H01	890	佐々木(信)
197	ファストランジェント/バースト試験機	(株)ノイズ研究所	FNS-AX3-B50B	H26	150	佐々木(信)
198	低温恒温高湿器	エスベック	PSL-2K	H19	240	佐々木(大)
199	静電気試験器	ノイズ研究所	ESS-S3011A	H29	200	伊藤(96)
200	衝撃波記録解析装置	Lansmont社	Test Partner TP3-USB	H26	100	近藤(康)
201	複合環境試験装置	IMV株式会社	EM2502(1250/SA5M)(振動試験機本体) Syn-3HA-40(恒温恒湿槽)	H26	1,720	佐々木(信)
202	真空乾燥器	EYELA	VOS-450SD	H09	130	遠田
203	自動研磨装置	ビューラー社	AUTOMET2&ECOMET3	H09	170	遠田
204	スクラバー付ドラフトチャンバー	オリエンタル技研工業(株)	GNE-1500N	H09	180	遠田
205	発熱量測定装置	(株)島津製作所	CA-4PJ	H10	110	遠田
206	粉塵ドラフト	オリエンタル技研(株)	GNS-1800S	H10	110	遠田
207	排ガス分析装置	(株)島津製作所	GC-17A	H10	120	遠田
208	ガスクロマトグラフ質量分析装置	横河アナリティカルシステムズ	Agilent 5973W	H12	180	遠田
209	ガスクロ用オートインジェクター	島津製作所	AOC-20i	H16	110	遠田
210	GC用熱分解装置	(株)島津製作所	PY-2020iD	H21	520	遠田
211	サイクロンサンプルミル	静岡精機(株)	CSM-F1	H20	110	遠田
212	ハロゲン化合物測定自動前処理装置	三菱化学(株)	AQF-100	H18	730	遠田
213	ビード作製装置	東京科学(株)	TK-4100型	H16	810	遠田
214	ハンディ型燃焼排ガス分析計	(株)テストー	t350システムXL	H23	130	遠田
215	粒度分布測定装置	日機装(株)	MT3300EX2-SDC-H	H25	580	遠田
216	赤外線サーモグラフィカメラ	日本アビオニクス(株)	R300SR-H	H26	100	遠田
217	ハロゲン化合物測定用検出器	Thermo SCIENTIFIC 社	ICS-1600	H26	410	遠田
218	ガス蒸気吸着量測定装置	日本ベル(株)	BELSORP-max	H26	920	遠田
219	超純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU665DA	H26	100	遠田
220	CHN元素分析装置	LECO	CHN628	R02	570	遠田
221	低温恒温恒湿器	タバイエスベック(株)	PL-3SP型	H05	180	遠田
222	分光光度計	(株)日立製作所	U-3000	H10	350	遠田
223	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent 7500 Series ICP-MS	H18	1,680	遠田
224	イオンクロマトグラフ(陰イオン・陽イオン・糖分析システム)	ダイオネクス	ICS-3000+2100型	H22	1,570	遠田

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
225	吸着性能評価装置	Quantachrome社	ChemBET-3000型	H16	700	遠田
226	バイオシェーカー	タイテック(株)	BR-43FL-MR	H23	110	遠田
227	分子量分布測定装置	(株)島津製作所	ProminenceGPCシステム	H25	390	遠田
228	高感度ガスクロマトグラフ	(株)島津製作所	Tracera	H27	470	遠田
229	波長分散型X線装置	(株)リガク	ZSX Primus IV	R01	1,170	遠田
230	微粉碎機	中央化工機(株)	MB-1	H09	110	遠田
231	粗粉碎機	三田村理研工業(株)	SR-2	H09	140	遠田
232	凍結粉碎器	日本分析工業	JFC-1500型	H15	300	遠田
233	小型タンデムリング粉碎機	中央化工機商事(株)	TR-LM	H24	110	遠田
234	アスファルト用乾燥機			S46	110	遠田
235	電子スピン共鳴測定装置	ブルカー・バイオスピン社	EMXplus型(マイクロ波ブリッジ含)	H25	1,830	鈴木
236	薄膜・粉末両用型高輝度X線回折装置	リガク	SmartLab9K-INP	H29	2,580	鈴木
237	蛍光X線膜厚計	セイコー電子工業	SEA-5120	H06	1,410	岡田
238	イオンスパッタ装置	日本電子(株)	JUC-5000	H04	2,040	岡田
239	マイクロオージェ電子分光装置	日本電子(株)	JAMP-7830F	H14	9,270	岡田
240	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	日本電子(株)	JSM-7900F	H30	5,490	菅原
241	実体顕微鏡	オリンパス	SZH-141	H04	350	岡田
242	光電子分光装置(ESCA)	アルバックファイ	5600MC	H04	17,910	千葉
243	卓上顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	Miniscope TM3030Plus,EDX:Quantax70	H27	770	千葉
244	高感度マグネットメータ	プリンストンメジャメント社	MicroMag2900	H05	4,510	鈴木
245	紫外分光式磁気特性評価装置	ネオアーク	BH-M800UV-HD-10	H17	1,410	山根
246	ポータブル型分光測定装置	ARCopix S.A社	ARCspectro FT-NIR Rocket 0.9-2.6	H26	210	山根
247	モノクロメータ式分光光源	朝日分光(株)	MAX-303+,CMS-100	H27	200	山根
248	2次元光検出器	ビットラン	BQ-73LN	H22	120	笠松
249	ダイヤモンド研磨システム	マルトー	ML-150P	H05	110	岡田
250	低速切断機	サウスベイテクノロジー	SBT650	H05	110	岡田
251	卓上プラズマエッチング装置	三友製作所	TP-50B	H27	470	伊勢
252	恒温恒湿槽	ADVANTEC	AGX-224	H07	310	荒川
253	静電容量微小変位計	ナノテックス	PS-III-5D	H16	110	荒川
254	純水・超純水製造装置	アドバンテック	RFU655DA・RFP543RA	H22	240	山根
255	金属顕微鏡	ニコン	XPF-UNRB	H04	960	伊勢
256	ハイトゲージ	ハイデンハイン	CERTO-CT60M	H06	430	伊勢
257	静電式パターンニング装置	エンジニアリングシステム(株)	QDX500-V-XC	H25	1,130	伊勢
258	ダイシング・ソー	ディスコ	DAD320	H07	1,470	内田(勝)
259	摩擦摩耗試験機	ブルカー・ジャパン(株)	UMT-TL-BASE	R01	900	関根
260	スパッタ・蒸着複合装置	トッキ	SPS506	H07	3,980	鈴木
261	分子線エピタキシー装置	エイコー・エンジニアリング	EW-100S	H17	4,870	鈴木
262	MBEプロセスモニタ用四重極質量分析システム	英国ハイデン社		H18	920	鈴木
263	スパッタ機用RFマッチングボックス	トッキ	RF-MN750	H19	220	鈴木

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
264	MBE装置用成膜及び表面処理機能拡張設備	株式会社エイコー	1EK00-36109-6501	H23	3,770	鈴木
265	補助ポンプ	サエスグループ(SAES Getters)	CapaciTorr D400-2	H26	100	鈴木
266	イオンビームガン	アリオス	EMIS-212	H17	440	内田(勝)
267	スパッタリング用パルス電源	日本MKS	RPG-50A-00	H17	290	内田(勝)
268	イオンミリング装置	コモンウェルス	ミラトロンIV	H04	1,940	鈴木
269	クライオコンプレッサー	ブルックス・オートメーション社	8200空冷式	H26	100	鈴木
270	ディスクスバッタ装置	日本真空技術	SSH-4S	H05	12,570	山根
271	純水・超純水製造装置	日本ミリポア株式会社	Milli-Q Integral 10	H21	230	鈴木
272	工場顕微鏡システム	ニコン	MM-11U	H04	2,990	伊勢
273	MEMS対応型マスクアライナ	ズース・マイクロテック	MA6BSA	H15	1,990	伊勢
274	超音波洗浄装置	本多電子	W118	H07	450	内田(勝)
275	サンプリングオシロスコープ	レクロイジャパン	9354TM	H07	160	黒澤
276	高速スペクトラムアナライザ	HP	E4401B	H11	280	黒澤
277	高速パルスジェネレータ	HP	HP81110A	H11	240	黒澤
278	ルビジウム周波数標準発振器	スタンフォードリサーチ	FS725	H17	110	黒澤
279	電波暗室・EMI測定システム	Rohde&Schwars	ESIB26a	H16	9,740	黒澤
280	電波暗室用センサスキャナ	デバイス	DM3423AV1/0	H19	210	黒澤
281	発振器	エヌエフ回路設計ブロック	WF1973	H19	110	黒澤
282	ロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5640	H19	110	黒澤
283	低ノイズアンプ	TSJ	MLA-00118-B01-35	H20	110	黒澤
284	高利得マイクロ波アンテナ	Electro Metrics	EM-6969	H21	110	黒澤
285	自動車用直流電源インピーダンス安定化回路網	Schwarzbeck Mess Elektronik	NNBM8125	H21	110	黒澤
286	CISPR22対応電波吸収体	TDK	IS-030A	H22	110	黒澤
287	電磁シールド特性評価システム	テクノサイエンスジャパン	KEC法測定システム	H22	120	黒澤
288	雑音電力測定システム	(株)東陽テクニカ	MAC600A-AJ, EPS/RFP-AJ	H25	100	黒澤
289	雑音測定用疑似通信回路網	協立電子工業(株)	KNW-2208, KNW-441, およびF-51	H25	100	黒澤
290	高周波発振器	アンリツ	MG3692C	H26	150	黒澤
291	放射・伝導イミュニティ試験システム	東陽テクニカ	IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 2008対応	H27	1,400	黒澤
292	車載機器放射イミュニティ用アンテナ	東陽テクニカ	イミュニティ試験システム	H29	200	黒澤
293	オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー(株)	DSOX6004A	H30	140	黒澤
294	EMS用発信器	ローデ・シュワルツ社	SMB100B	R01	110	黒澤
295	電子負荷	(株)計測技術研究所	LN-300A-G7	H26	100	木谷
296	EMC試験用交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000S+ES2000B×2台	H27	250	木谷
297	EMIレシーバー	ローデ・シュワルツ社	ESW-26, TEPTO-DV/RE, TEPTO-DV/CE, TEPTO-DV/PE	H30	880	木谷
298	電源周波数磁界イミュニティ試験装置	株式会社 テクノサイエンスジャパン	IEC61000-4-8対応	R02	190	木谷
299	触針式表面形状測定装置	アルバック	DEKTAK150	H21	250	千葉
300	高分解能走査型プローブ顕微鏡	ブルカー・ジャパン株式会社	Dimension Icon	R02	2,000	久住
301	分光エリプソメータ	日本セミラボ株式会社	SE2000	H28	1,130	山根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
302	分光エリブソメータ用反射率測定モジュール	日本セミラボ株式会社	SE-2000用	H30	440	山根
303	MTF評価装置	トライオプティクス	Image Master HR LP	H21	550	梁瀬
304	金属顕微鏡システム	オリンパス	BH3-MJL	H06	1,520	梁瀬
305	ナノ加工用イオンビーム装置	日本セミラボ株式会社	SMI2050	H14	4,090	伊勢
306	クリーンブースB(H17導入)	日本エアーテック	ECB02-22D5	H17	130	伊勢
307	マイクロスコープ	ハイロックス	KH-7700	H19	230	伊藤(97)
308	小型赤外線サーモグラフィ	(株)アピステ	FSV-210L	H30	170	伊藤(97)
309	スペクトラムアナライザ	HP	HP4396B	H09	930	荒川
310	FFTアナライザ	HP	HP35670A	H05	1,150	荒川
311	デジタルオシロスコープ	HP	HP54542A	H05	780	荒川
312	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1157	H05	620	荒川
313	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1165	H05	340	荒川
314	レーザードップラー振動計	小野測器	LV-1500	H05	1,150	荒川
315	FFTサーボアナライザ	HP	HP35670A	H07	640	荒川
316	高分解能オシロスコープ	HP	HP54540C	H07	400	荒川
317	高分解能光ファイバー式変位計	フォトニクス	ATW-01 +ATP-A20	H12	220	荒川
318	高周波連続可変フィルタ(H13導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H13	110	荒川
319	FFTアナライザ	アジレントテクノロジー	35670A	H17	170	荒川
320	5ch 静電容量変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	H17	110	荒川
321	オートコリメータ	ニコン	6B	H18	220	荒川
322	超高分解能光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ (株)	BH20	H18	110	荒川
323	平面検出型光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ (株)	BZ	H18	110	荒川
324	FFTアナライザ	小野測器	DS-2100	H19	220	荒川
325	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ (株)	BH20	H20	110	荒川
326	ロジックアナライザ	アジレントテクノロジー(株)	16804A	H20	240	荒川
327	オシロスコープ	アジレントテクノロジー(株)	DSO7104A	H21	110	荒川
328	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ (株)	BH25, BD96-B1400HC特	H21	120	荒川
329	ファンクションジェネレータ(2ch出力)	テクトロニクス株式会社	AFG3252	H21	110	荒川
330	レーザ干渉変位計システム	株式会社小野測器	LV-2100	H21	130	荒川
331	除振台	明立精機	MAPS-008A-G1010	H22	270	荒川
332	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社	L-trace II	H24	680	荒川
333	レーザドップラ振動計	小野測器	LV-1800	H25	140	荒川
334	振動周波数分析器	株式会社エヌエフ回路設計ブロック	FRA5097	H25	130	荒川
335	微小トルク検出器	ユニパルス	UTM II -0.05Nm	H26	100	荒川
336	ピコメートル分解能非接触変位計	(株)マグネスケール	BN100	H26	100	荒川

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
337	高分解能反射型レーザースケール	(株)マグネスケール	BF1,BD-96	H26	100	荒川
338	差動型非接触振動計	小野測器(株)	LV-1800	H26	150	荒川
339	デジタルオシロスコープ	キーサイトテクノロジー	DSOS104A	H29	230	荒川
340	GMR評価高磁界用マグネット電源	菊水電子工業	PBX20-20	H10	110	山根
341	発振器	HP	HP81110A	H11	240	木谷
342	クリーンブースC(H17導入)	日本エアテック	ACB-352C-特型	H07	130	木谷
343	光学顕微鏡	ニコン	MM-11U	H07	590	木谷
344	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H09	440	木谷
345	ロングメモリオシロスコープ	レクロイ	LC574AL	H11	680	木谷
346	オシロスコープ	AgilentTechnologies	54622A	H12	110	木谷
347	高精度スピンスタンド	協同電子システム	LS1000/500PS-II K	H16	2,510	木谷
348	磁気抵抗測定装置	ハヤマ	MRMS-10K	H20	3,770	鈴木
349	スイッチ・マトリクス	ケースレーインツルメンツ株式会社	4200-UL-LS-12	H21	110	鈴木
350	GPIB直流電源装置	菊水電子	PB×40-5	H05	260	千葉
351	小型旋盤	エムコ社	コンパクト8	H05	590	伊藤(97)
352	立型帯鋸盤	ラクソー	VWS-55	H05	280	伊藤(97)
353	静電力発生用高圧電源システム	松定プレジジョン	HAR-30P73.3	H27	100	荒川
354	ハイスピードマイクロスコープ	キーエンス	VW-9000	H28	400	荒川
355	粘度計	ブルックフィールド社	DV2TCP	H29	100	荒川
356	表面張力計	協和界面科学	DY-500	H29	170	荒川
357	高速カメラ	(株)ディテクト	HAS-D3M	H25	110	笠松
358	偏光顕微鏡	オリンパス光学工業(株)	BHS-751-P型	S62	110	梁瀬
359	高性能LD光源	メスグリオ	56RCS002/HV	H21	110	梁瀬
360	色彩輝度計	コニカミノルタ	分光フィッティング方式 CS-200	H25	130	梁瀬
361	可視光対応光スペクトラムアナライザ	横河計測	AQ6374-10-L1-D/FC/RFC	R02	340	梁瀬
362	液晶配向シミュレータ	シンテック(株)	LCD MASTER 3D	H18	190	梁瀬
363	ラビング装置	E.H.C(株)	MR-100	H18	270	梁瀬
364	UV加圧硬化装置	E.H.C(株)	MLP-320G	H19	110	梁瀬
365	シール剤塗布装置	岩下エンジニアリング	Ez-ROBO5/ACCURA DG	H20	110	梁瀬
366	アッペ屈折計	アタゴ	DR-M4/1550	H21	110	梁瀬
367	ヘッド観察用顕微鏡セット(ポアスコープ)	オリンパス	G080-034-090-55	H05	110	梁瀬
368	照明光学系設計システム	Zemax社	OpticStudio Professional版	H27	220	梁瀬
369	LCRメータ	HP	HP4284A	H07	610	荒川
370	ズーム顕微鏡	ユニオン光学(株)	DZ2-SH	H09	230	笠松
371	標準電圧電流発生器	アドバンテスト	R6161	H05	230	内田(勝)
372	マルチメータ	HP	HP3458A	H05	340	内田(勝)
373	アンプ付き電流プローブ	ソニーテクトロニクス	AM503S+op05	H11	110	木谷
374	デジタルオシロスコープ	LeCroy	WR6051A	H16	110	木谷
375	インピーダンスアナライザ	HP	HP4291A	H06	1,680	黒澤

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
376	誘電率測定フィクスチャ	Agilent	16453A	H20	110	黒澤
377	大規模データ処理用並列分散計算クラスタリングシステム	IBM	eServer325	H16	150	黒澤
378	高周波連続可変フィルタ(H11導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H11	180	木谷
379	フォトリソグラフ用クリーンオープン	榎本化成	CSO-402BF	H12	160	内田(勝)
380	スピンコータ	ミカサ株式会社	MS-A150	H21	140	内田(勝)

秋田県産業技術センター
業務年報

2020年(令和2年度)

編集・発行：秋田県産業技術センター

〒010-1623

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4番地の11

あきたけん あきたし あらやまち あざ さぬき

TEL 018-862-3414(代表)

FAX 018-865-3949(代表)

TEL 018-866-5800(技術相談窓口)

FAX 018-866-5803(技術相談窓口)

E-mail : soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

Home page : <http://www.aitc.pref.akita.jp/>